## PCT

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Arlikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	-1-1				
	WEITERES Siehe	Formblatt PCT/ISA/220 sowie, soweit			
E 0707 WO Internationales Aktenzeichen		zutreffend, nachstehender Punkt 5			
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum			
PCT/EP2004/051008	(Tag/Monat/Jahr) 03/06/2004	(Tag/Monat/Jahr)			
Anmelder	03/08/2004	12/07/2003			
7 timelagi					
)					
LEICA MICROSYSTEMS SEMICOND	UCTOR GMBH				
Dieser internationale Recherchenbericht wur	de von der Internationalen Recherche	enbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß			
Artikel 18 übermittelt. Eine Kople wird dem Ir	iternationalen Büro übermittelt.	with delivering the delivering gentals			
Dieser internationale Recherchenbericht umf	aßtinscesamt 4 s	Blätter.			
	ene enne Kobie dei in diesem Bericht (	genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.			
Grundlage des Berichts					
a. Hinsichtlich der Sprache ist die Inten	nationale Recherche auf der Grundlag	ge der internationalen Anmeldung in der Sprache			
durchgeführt worden, in der sie einge	reicht wurde, sofern unter diesem Pu	nkt nichts anderes angegeben ist.			
internationalen Anme	eldung (Regel 23.1 b)) durchgeführt w	ei der Behörde eingereichten Übersetzung der orden			
- I mountain der mer mer me	nonaien Annieldung offenbarten Nucl	leotid- und/oder Aminosäuresequenz siehe Feld Nr. 1			
2. Bestimmte Ansprüche habe	en sich als nicht recherchierbar erv	rice - John F-1-1 III			
· ·	and the metric recite cities out etc.	wesen (siene Feld II).			
3. Mangelnde Einheitlichkeit d	ler Erfindung (siehe Feld III).				
	armidding (siene reid iii).				
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind	una				
wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.      wurde der Wortlaut von der Behörde wie folgt festgesetzt:					
water act worthant worthing a	enorda wie lolgt lesigesetzt:				
•					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung					
X wird der vom Anmelder eingel	eichte Wortlaut genehmint				
	_	enen Fassung von der Behörde festgesetzt.			
Dei Allineidei Kallii dei Delloi	de ilineinaid eines Monais nach dem	Datum der Absendung dieses Internationalen			
Recherchenberichts eine Stell	ungnahme vodegen.				
6. Hinsichtlich der Zeichnungen					
a. Ist folgende Abbildung der Zeichnung	en mit der Zusammenfassung zu veri	öffentlichen: Abb. Nr. 4			
X wie vom Anmelder von		onondionali, Aub. Nr. ±			
	•	halan Albitta			
	ausgewählt, weil der Anmelder selbst				
	usgewählt, weil diese Abbildung die I				
b wird keine der Abbildungen mi	t der Zusammenfassung veröffentlich	t.			

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 1) (Januar 2004)

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G06T7/00 G01N21/88

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE
Recherchierter Mindestprülstolt (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 G06T G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprülstolt gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie\* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

U. ALS 172	C. ALS WESENTLICH ANGESEHERE UNTERLAGEN		
Kalegorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
Y	US 2002/184172 A1 (GLEIBMAN ANDREW ET AL) 5. Dezember 2002 (2002-12-05) Absatz '0050! - Absatz '0051!	1-14	
Y	BREAUX L ET AL: "Automatic defect classification system for patterned semiconductor wafers" SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, 1995., IEEE/UCS/SEMI INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AUSTIN, TX, USA 17-19 SEPT. 1995, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 17. September 1995 (1995-09-17), Seiten 68-73, XP010193372 ISBN: 0-7803-2928-7 Abschnitt III Offline ADC Technology	1-14	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamille
Besondere Kalegorien von angegebenen Veröffentlichungen:  A' Veröffentlichung, die den aligemeinen Sland der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist  E' älleres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist  'L' Veröffentlichung, die geeignel ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft erschelnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)  'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Aussiellung oder andere Maßnahmen bezieht 'P' Veröffentlichung, die vor dem Internationalan Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	<ul> <li>*T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdalum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzips oder der ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist</li> <li>*X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtel werden</li> <li>*Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtel werden veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung für einen Fachmann nahellegend ist</li> <li>*&amp;* Veröffentlichung, die Mitglied derseiben Patentfamilie ist</li> </ul>
Datum des Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
18. November 2004	28/12/2004
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Alfswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Reise, F

1

PCT/	EP2004.	/051008
------	---------	---------

		P2004/051008 .		
C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kalegorie*	Bezelchnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
A	JÄHNE B: "Pixelverarbeitung" DIGITALE BILDVERARBEITUNG, Juni 2001 (2001-06), Seiten 257-295, XP002306421 SPRINGER VERLAG, BERLIN, DE ISBN: 3540412603 Seite 263 - Seite 264, Abschnitt "Nachweis von Unter- und Überlauf"	1,8		
Α	LI J ET AL: "Production use of an integrated automatic defect classification (ADC) system operating in a laser confocal/white light imaging defect review station"  ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CONFERENCE AND WORKSHOP, 1996. ASMC 96 PROCEEDINGS. IEEE/SEMI 1996 CAMBRIDGE, MA, USA 12-14 NOV. 1996, NEW YORK, NY, USA, IEEE, US, 12. November 1996 (1996-11-12), Seiten 107-111, XP010204507 ISBN: 0-7803-3371-3 das ganze Dokument			
A	READING I ET AL: "Development of Automated Wafer Bump Inspection Technology" SIMTECH TECHNICAL REPORT, 2001, Seiten 1-6, XP002306422 Seite 3			